

<http://physicsweb.org/article/news/4/3/5>

2000/03/03

## روش‌های جدید برای بلورهای فتوئیکی ارزان‌تر

بلورهای فتوئیکی موادی اند که گافی فتوئی دارند، مثل نیم‌رساناهای گافی الکترونی دارند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختن بلورهای فتوئیکی تهییه‌ی ساختارها بی‌است که در طول موج‌های مرئی کار کنند. بلورهای فتوئیکی را با درست‌کردن حفره‌ها بی‌در مواد می‌سازند. اندازه‌ی حفره‌ها و فاصله‌ی آن‌ها از هم طول موج کار بلور را تعیین می‌کند. آندرو تیرفیلد [1] و هم‌کارانش از دانش‌گاه آکسفورد [2] در بریتانیا، روش جدیدی برای ساخت بلورهای فتوئیکی برای تابش مرئی بار آورده اند، که شاید به نسلی دیگری از مدارهای یکپارچه‌ی فتوئیکی منجر شود [3].

اساس کار انجماد رزینی است که با نور دیدن سفت می‌شود. این رزین را در نقشی تداخلی حاصل از چهار باریکه‌ی متقاطع لیزر می‌گذارند و به این ترتیب یک شبکه‌ی سه‌بعدی از آن می‌سازند. سپس درون شبکه را با تیتانیم دی‌اکسید پر می‌کنند و می‌گذارند شکل آن را به خود بگیرد. بعد رزین را می‌سوزانند و بلور فتوئیکی درست می‌شود.

روش‌های دیگر تولید بلورهای فتوئیکی بر اساس نشاندن شیمیایی، یا روش‌های تغییر‌شکل یافته‌ی ساخت نیم‌رساناهای است. اما هریک از این روش‌ها عیوب‌ها بی‌دارد. تیرفیلد می‌گوید: "روشی ما خیلی انعطاف‌پذیرتر از روش‌های دیگر است. سریع، ارزان، و بسیار انعطاف‌پذیر است." تعداد لایه‌ها بی‌که با این روش می‌شود به دست آورده تا ده برابر تعداد لایه‌ها در ساختارهای حاصل از نشاندن شیمیایی است.

تیرفیلد می‌گوید قدم بعدی درست‌کردن ماده‌ای است که خواص اپتیکی آن در همه‌ی جهات یکسان باشد، و تولید نقص در آن. با این کار می‌شود گستره‌ی وسیعی از مدارهای بر اساس فتوئیک ساخت.

X0/000305

γ

[1] Andrew Turberfield

[2] Oxford

[3] Nature **404** 53